

# マイクロコンタクトプリンター PA400k

次世代  
ツール

注目のマイクロコンタクトプリンティング  
この1台でスタンプマスター製作から  
マイクロコンタクトプリントまで対応!

## マイクロコンタクトプリント実験装置

DeepUV マスクアライナー機能付き

本装置は、ハーバード大学のG.Whitesidesによって提唱された「マイクロコンタクトプリンティング(micro contact printing)」法に対応するマイクロコンタクトプリンター装置です。マイクロコンタクトプリンティング法は急速に展開してきた有機エレクトロニクス分野やバイオ用マイクロ構造体など次世代デバイス製造法として注目を集めています。

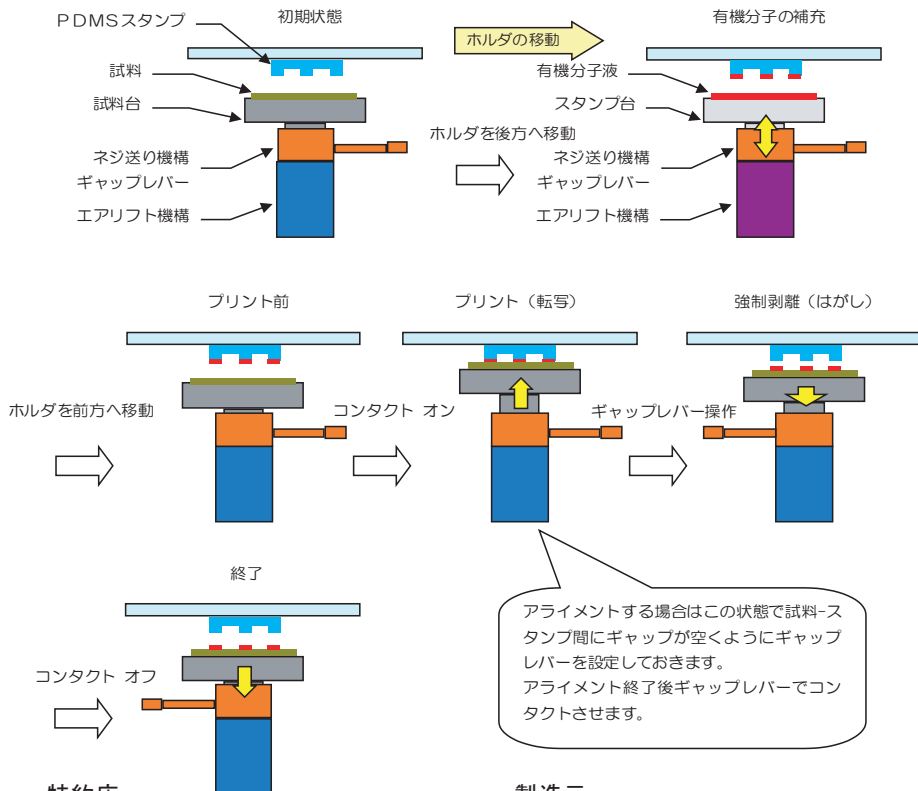
PDMS (ポリジメチルシロキサン) スタンプを取り付け、試料上にセルフアSEMBル膜を転写できます。さらにDeepUV光源コンタクト方式マスクアライナーとしてもご使用頂けますので、スタンプマスターの製作なども可能です。各機構操作部を手動としたシンプルな構成で、多方面での応用が利くローコストで使い勝手の良い装置です。



(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)

### 主な仕様

- ◆プリント形式 Wステーション方式(プリント/露光&スタンプ台 ステーション)
- ◆アライメント機構概要 XYZθφ(平行)軸 ミトヨ製 Z軸高さ測長器 分解能1μm エアシリンダコンタクト方式
- ◆スタンプ台機構概要 Zφ(平行)軸 ミトヨ製 Z軸高さ測長器 分解能1μm エアシリンダコンタクト方式
- ◆適応試料(手前下側) サイズ 最大□6インチ 厚さ最大 t=700μm程度 但し最大露光エリア 約φ30mm
- ◆適応スタンプ(上側:マスクアライナー時は適応マスク) サイズ 最大□4インチ 厚さ 0.06インチまたは0.09インチ ※1
- ◆適応スタンプ台(後方下側) サイズ 最大□4インチ 厚さ最大 t=500μm程度 ※1



※1 試料またはスタンプ台とスタンプ(マスク)の厚み合計が最大で5mm程度であれば使用可能です。

- ◆露光方式 1:1等倍露光 コンタクト(コンタクト圧調整可)およびプロキシミテイ
- ◆露光性能 インテグレートレンズ方式 200W Hg-Xeランプ 約□30mm 均一度 ±5% DeepUV対応 λ=254~500nm
- ◆アライメント方式 双対物CCD&モニタ観察顕微鏡による目視アライメント
- ◆寸法/重量 670(H)×460(W)×540(D)mm以内 300Kg以下 制御ボックス、ランプハウス電源は別置きです。
- ◆ユーティリティ 真空 600mmHg以上 窒素またはドライエア 5Kg/cm<sup>2</sup>以上 電源 AC100V 8A(最大)

アライメントする場合はこの状態で試料-スタンプ間にギャップが空くようにギャップレバーを設定しておきます。アライメント終了後ギャップレバーでコンタクトさせます。

特約店

SANMEI GROUP IDENTITY  
**sanmei** 株式会社 三明  
〒424-0825静岡県静岡市清水松原町6-16  
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元

**株式会社 ナノテック**  
Nanometric Technology Inc.

〒174-0041東京都板橋区舟渡3-5-8-201

特願2003-364840

**www.nanotech-inc.co.jp**  
**info@nanotech-inc.co.jp**

電話 (03)3960-3171 Fax (03)3960-3174